

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年9月15日(15.09.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/190448 A1

- (51) 国際特許分類:
C23F 1/16 (2006.01) *H01L 21/308* (2006.01)
H01L 21/306 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/038231
- (22) 国際出願日: 2021年10月15日(15.10.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-038475 2021年3月10日(10.03.2021) JP
特願 2021-167898 2021年10月13日(13.10.2021) JP
- (71) 出願人: 花王株式会社(**KAO CORPORATION**)
[JP/JP]; 〒1038210 東京都中央区日本橋茅場
町一丁目14番10号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 木村 陽介 (**KIMURA Yosuke**). 岡崎
翔太(**OKAZAKI Shota**).
- (74) 代理人: 特許業務法人池内アンドパートナ
ーズ(**IKEUCHI & PARTNERS**); 〒5306026 大
阪府大阪市北区天満橋1丁目8番30号
O A Pタワー26階 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
- ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) **Title:** ETCHANT COMPOSITION

(54) 発明の名称: エッチング液組成物

(57) **Abstract:** In one aspect, an etchant composition that can reduce etching unevenness is provided. In one aspect, the present disclosure relates to an etchant composition for etching a layer of interest containing at least one type of metal, the etchant composition comprising an etching suppressing agent, an acid comprising at least nitric acid, and water, and having a pH value of 1 or less, in which the etching suppressing agent comprises at least one nitrogen-containing compound selected from polyalkylene imine and a polymer containing a diallylamine-derived constituent unit.

(57) 要約: 一態様において、エッチングむらを低減できるエッチング液組成物を提供する。本開示は、一態様において、少なくとも1種の金属を含む被エッチング層をエッチングするためのエッチング液組成物であって、前記エッチング液組成物は、エッチング抑制剤と、少なくとも硝酸を含む酸と、水とを含み、pHが1以下であり、前記エッチング抑制剤は、ポリアルキレンイミン、及び、ジアリルアミン由来の構成単位を含むポリマーから選ばれる少なくとも1種の窒素含有化合物である、エッチング液組成物に関する。



WO 2022/190448 A1